

05; 10; 11

© 1992

СПЕКТР ОДНОКРАТНЫХ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ
ЭЛЕКТРОНОВ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФУЛЛЕРЕНА C_{60}

В.И. Рубцов, Ю.М. Шульга

В настоящее время известен уже ряд работ по исследованию электронной структуры твердых тел на основе бакминстер-фуллеренов методами спектроскопии потерь энергии электронов [1-7]. Однако данные разных авторов о положении и числе максимумов на спектре различаются и часто являются довольно противоречивыми. Так, для положения основного максимума, обусловленного возбуждением $(\sigma + \pi)$ -плазмона, приводятся значения 29.2 эВ [1]; 27.6 эВ [2, 3]; 26 эВ [4] и 25.5 эВ [5, 6]. В области потерь на возбуждение π -плазмона авторы работы [2] отмечают 5 максимумов, тогда как в работе [4] приводится только одно значение для энергии π -плазмона, равное 6.5 эВ. Причиной отмеченных несовпадений может быть то, что в перечисленных работах изучались разные объекты, хотя их основа одна и та же – молекула C_{60} . Другой причиной расхождений может быть вклад много-кратного рассеяния электронов, который искажает форму спектра и эффективно смещает положения максимумов. При исследовании спектров потерь, сопровождающих фотоэлектронный пик Cis [2, 3, 7], заметный вклад могут давать потери, происходящие одновременно с возникновением вакансии на внутреннем электронном уровне вследствие фотоионизации (внутренние потери).

Цель настоящей работы – получить спектр однократных потерь энергии электронов для поликристаллического C_{60} , который можно сопоставлять с функцией потерь, полученной из независимых экспериментов или теоретических расчетов электронной структуры бакминстер-фуллерена C_{60} .

Методика синтеза и очистки C_{60} от примеси других фуллеренов была описана в работе [7]. Поликристаллическое покрытие с содержанием C_{60} не менее 99 % наносилось на алюминиевую подложку и имело эффективную толщину 0.1-0.9 мкм.

Для сравнения измерялись также спектры потерь графита, образцы которого для съемки готовили путем прессования поликристаллических порошков. Предполагается, что при такой подготовке не существует преимущественной ориентации кристаллов в зоне анализа.

Электронные спектры измерялись на спектрометре РН1-551, оснащенном анализатором типа двойного цилиндрического зеркала с приставкой для угловых измерений и с коаксиальной анализатором электронной пушки. Анализатор использовался в режиме задержи-

вающего потенциала с абсолютным разрешением 0.7 эВ. Пучок первичных электронов имел энергию 2000 эВ и полуширину энергетического распределения 0.5 эВ. Угол падения первичных электронов составлял 42° относительно внешней нормали к поверхности, регистрация вторичных электронов велась под прямым углом к поверхности, разрешение по углам составляло 8° . Давление остаточных газов в измерительной камере не превышало $3 \cdot 10^{-10}$ Тор.

Измеренные спектры корректировались на зависимость коэффициента пропускания анализатора от кинетической энергии анализируемых электронов. Спектры однократных потерь $y(E)$ определялись из решения интегрального уравнения [8]:

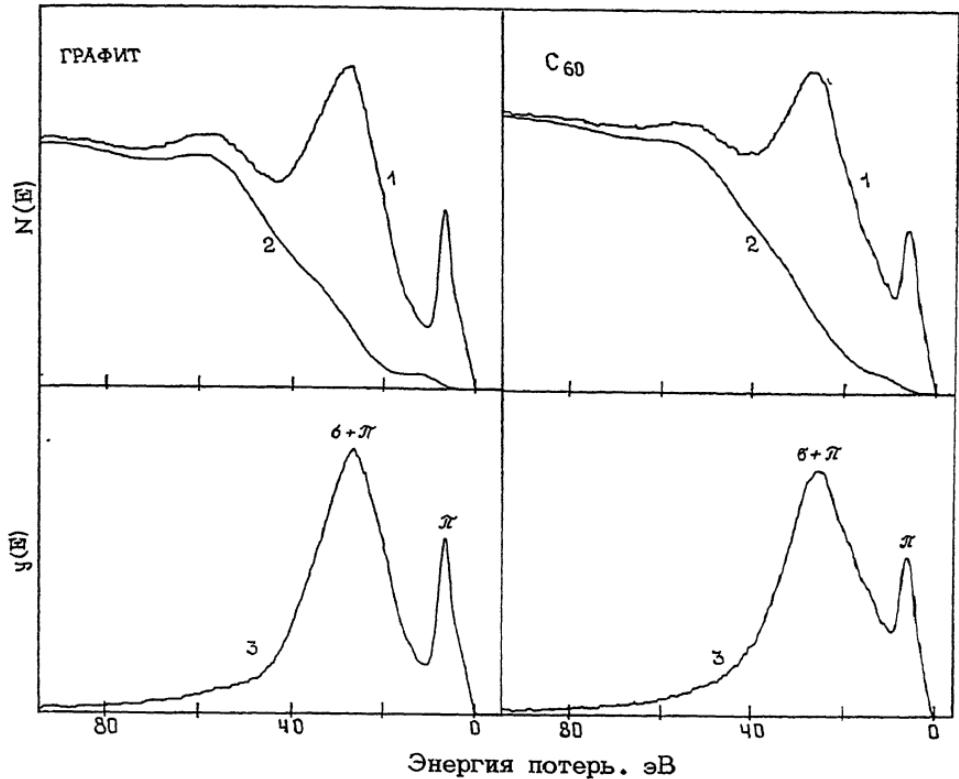
$$N^{in}(E) - ky(E) * N^{in}(E) = ky(E), \quad (1)$$

где $*$ означает свертку по энергии, $N^{in}(E)$ – неупругая часть спектра потерь энергии электронов, нормированная на площадь под упругим пиком, k – фактор, учитывающий геометрию эксперимента по отражению электронов. Методика разделения спектров характеристических потерь на квазиупругую и неупругую части, а также учет влияния аппаратной функции спектрометра аналогичны описанным в работе [9].

Экспериментальные спектры потерь $N(E)$ и спектры однократных потерь $y(E)$ для графита и C_{60} приведены на рисунке. Видно, что спектры обоих веществ имеют два основных максимума, которые обусловлены возбуждением плазменных колебаний всех валентных электронов ($\sigma + \pi$ -плазмон), и отдельно – π -подсистемы (π -плазмон). Максимумы спектра для C_{60} находятся при 25.2 и 5.6 эВ, а для графита – при 26.6 и 6.6 эВ. Положения максимумов для графита согласуются с литературными данными [8, 10–15]. В то же время значения для C_{60} близки к полученным в экспериментах по прохождению электронов высоких энергий (100–200 кэВ) через тонкие слои C_{60} [4–6], и отличаются от значений, полученных при исследовании спектра отраженных электронов (без вычитания фона многократного рассеяния) [1] и сателлитной структуры рентгеновских фотоэлектронных спектров *Cis* [2, 3].

Как видно из рисунка и приведенных цифр, положение максимума ($\sigma + \pi$) на спектре потерь для C_{60} несколько ниже энергии ($\sigma + \pi$)-плазмона для графита. Однако значение 25.2 эВ для этого максимума не отражает значительно более низкую объемную плотность твердого C_{60} ($1.65 \text{ г}/\text{см}^3$ [16] по сравнению с $2.25 \text{ г}/\text{см}^3$ для графита), что согласуется с выводами работ [5, 7].

Отличие спектров однократных потерь C_{60} от спектров графита заключается не только в сдвиге основных максимумов в сторону более низких потерь: в области между основными максимумами в случае C_{60} наблюдается более высокая интенсивность потерь. Это согласуется с результатами теоретических расчетов функции электромагнитного отклика для кластера C_{60} [17], где отмечается



Экспериментальные спектры потерь (1) и спектры однократных потерь (3) для поликристаллических образцов графита и C_{60} : (2) – линия, отделяющая спектр однократных потерь от фона многократного рассеяния, $E_p = 2$ кэВ.

наличие широкой полосы переходов в „промежуточном“ энергетическом диапазоне $\hbar\omega = 10\text{--}20$ эВ.

На спектре однократных потерь C_{60} можно выделить и другие особенности, интенсивности которых малы по сравнению с основными пиками. Сравнивая спектр на рисунке со спектром потерь, сопровождающим рентгеновский фотоэлектронный спектр Cis [2], можно сделать вывод о том, что четыре пика в диапазоне 1–5 эВ, обнаруженные авторами работы [2] вблизи фотоэлектронного пика Cis , видимо, являются следствием внутренних потерь, которые происходят одновременно с ионизацией внутреннего $2s$ -уровня. При возбуждении спектра потерь внешними по отношению к рассеивающей среде электронами такие процессы также могут иметь место, но их вклад в измеряемый спектр сравнительно мал и на спектре практически не обнаруживается.

Список литературы

- [1] Tong W.M., Ohlberg D.A.A., You H.K. et al. // J. Phys. Chem. 1991. V. 95. N 12. P. 4709-4712.
- [2] Weaver J.H., Martins J.L., Komedaa T. et al. // Phys. Rev. Lett. 1991. V. 66. N 13. P. 1741-1744.
- [3] Jost M.B., Trouillier N., Poirier D.M. et al. // Phys. Rev. B. 1991. V. 44. N 4. P. 1966-1971.
- [4] Saito Y., Shinohara H., Ohshita A. // Jap. J. Appl. Phys. A. 1991. V. 30. N 6. P. L1068-L1071.
- [5] Hansen P.L., Fallon P.J., Kratschmer W. // Chem. Phys. Lett. 1991. V. 181. N 1. P. 367-370.
- [6] David V.P., Lin S., Carreres M.M. // Chem. Phys. Lett. 1991. V. 185. N 1,2. P. 75-81.
- [7] Шульга Ю.М., Моравский А.П., Лобач А.С., Рубцов В.И. // Письма в ЖЭТФ. 1992. Т. 55. В. 2. С. 137-140.
- [8] Михайлов Г.М., Рубцов В.И. // Поверхность. 1987. В. 7. С. 99-105.
- [9] Михайлов Г.М., Бородько Ю.Г. // Поверхность. 1982. № 6. С. 85-90.
- [10] Taft E.A., Philipp H.R. // Phys. Rev. 1965. V. 138. N 1A. P. 197-202.
- [11] Caputi L.S., Paragnone L. // Phys. Lett. A. 1983. V. 93. N 8. P. 417-419.
- [12] Caputi L.S., Chiarello S., Santaniello A. et al. // Phys. Rev. B. V. 34. N 9. P. 6080-6085.
- [13] Hsiao-chia Tsai, Boddi D.B. // J. Vac. Sci. Technol. A. 1987. V. 5. N 6. P. 3287-3312.
- [14] Berger S.D., McKenzie D.R., Martin P.J. // Phil. Mag. Lett. 1988. V. 57. N 5. P. 285-287.
- [15] Martin P.J., Filippczuk S.W., Netterfield R.P. et al. // J. Matter. Sci. Lett. 1988. V. 7. N 4. P. 410-412.
- [16] Kratschmer W., Lamb L.D., Fostiropoulos K., Huffman D.R. // Nature. 1990. V. 347. P. 354-356.
- [17] Beretsch G.F., Bulgac A., Tomaneck D., Wang Y. // Phys. Rev. Lett. 1991. V. 67. N 19. P. 2690-2693.

Поступило в Редакцию
4 апреля 1992 г.